

Příklady shody/podobnosti nároků

Nároky v následujících případech jsou považovány za „dostatečně si odpovídající“.

Příklad 1

<i>US nároky</i>	<i>CZ nároky</i>	<i>Poznámka</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>CZ nárok obsahuje přídavný prvek oproti nároku udělenému USPTO.</i>

Patentovatelný nárok dle USPTO	CZ nárok
<p>A system for presenting a container storing at least one article to a processing tool, comprising:</p> <p>(a) a load port, including:</p> <p>a frame having an opening;</p> <p>a support structure being adapted to receive a container, and</p> <p>a drive mechanism for moving said support structure substantially vertically between a first height and a second height; and</p> <p>(b) a conveyor for movably supporting the container substantially along a container transport plane;</p> <p>wherein a container traveling on said conveyor moves unobstructed over said support structure when said support structure is located in said second height,</p> <p>wherein the container traveling unobstructed does not contact said support structure while traveling over said support structure located at said second height,</p> <p>wherein said support structure, when located at said second height, is located below said transport plane.</p>	<p>Systém pro přivádění kontejneru obsahujícího alespoň jeden výrobek k výrobnímu nástroji, zahrnující:</p> <p>(a) úložné místo, které zahrnuje:</p> <p>rám vykazující otvor;</p> <p>nosnou konstrukci uzpůsobenou pro přijímání kontejneru, a</p> <p>hnací mechanismus pro přemísťování uvedené nosné konstrukce v podstatě vertikálně mezi první výškou a druhou výškou; a</p> <p>(b) dopravník pro přemísťování kontejneru v podstatě podél transportní roviny kontejneru; ve kterém se kontejner pohybuje se prostřednictvím uvedeného dopravníku tehdy, kdy se uvedená nosná konstrukce nachází v uvedené druhé výšce, bez překážek přemísťuje přes uvedenou nosnou strukturu, ve kterém bez překážek se pohybující kontejner nepřichází, zatímco se přemísťuje přes uvedenou nosnou konstrukci nacházející se v uvedené druhé výšce, do styku s uvedenou nosnou konstrukcí, ve kterém se uvedená nosná konstrukce při umístění v uvedené druhé výšce nachází pod uvedenou transportní rovinou,</p> <p><u>s tím, že uvedená nosná konstrukce se, při umístění v uvedené první výšce, nachází nad uvedenou transportní rovinou*</u>.</p>
<p>*Tyto přídavné prvky NEJSOU zahrnuty v nároku schváleném USPTO, ale jsou zahrnuty v popise US přihlášky.</p>	

Příklad 2

<i>US nároky</i>	<i>CZ nároky</i>	<i>Poznámka</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Tentýž</i>
<i>žádný</i>	<i>2</i>	<i>CZ nárok 2 závisí na CZ nároku 1, který byl schválen USPTO.</i>

Patentovatelný nárok dle USPTO	CZ nárok
1. A nitride-based semiconductor device comprising: a first semiconductor layer, consisting of either an n-type nitride-based semiconductor layer having a wurtzite structure or an n-type nitride-based semiconductor substrate having a wurtzite structure; and an n-side electrode formed on a back surface of said first semiconductor layer, wherein a dislocation density is not more than $1 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2}$ in the vicinity of the interface between said first semiconductor layer and said n-side electrode, and contact resistance between said n-side electrode and said first semiconductor layer is not more than $0.05 \text{ } \Omega\text{cm}^2$.	1. Polovodičová součástka založená na nitridu zahrnující: první polovodičovou vrstvu, sestávající buď z polovodičové vrstvy založené na nitridu n-typu mající strukturu wurtzitu, nebo z polovodičového substrátu založeného na nitridu n-typu majícího strukturu wurtzitu; a elektrodu n-typu vytvořenou na zadní ploše první polovodičové vrstvy, přičemž hustota dislokací není vyšší než $1 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2}$ v blízkosti rozhraní mezi první polovodičovou vrstvou a řečenou elektrodou n-typu, a odpor kontaktu mezi elektrodou n-typu a první polovodičovou vrstvou není vyšší než $0,05 \text{ } \Omega\text{cm}^2$.
2. (Žádný)	2. Polovodičová součástka založená na nitridu podle nároku 1, kde řečená první polovodičová vrstva zahrnuje příměs n-typu.*
<i>Poznámka:</i>	↓ <u>*Tato dodatečná část / druhý nárok / NENÍ zahrnuta v nároku uděleném USPTO, ale je zahrnuta v popisu US přihlášky.</u>